

新濱敦史

2021/1

#### 概要

タングステンのフィラメントを熱陰極とする,グロー放電プラズマの水素分子発光スペクトルを,ツェルニ・ターナー型分光器と CCD カメラを用いて計測した.得られたスペクトルから,Fulcher-  $\alpha$  帯 Q 枝の発光線を特定し,その発光強度を計算した.発光強度から発光上準位の振動・回転状態占有率を計算し,回転エネルギーに対するボルツマンプロットを作成した.発光上準位の占有率にボルツマン分布を仮定しボルツマンプロットを直線でフィッティングすることによって,その傾きから発光上準位の回転温度を求めた.コロナモデルを適用するとともに基底準位の振動・回転状態占有率にもボルツマン分布を仮定することで,基底準位の振動温度を求めた.最後に,基底準位の振動・回転状態占有率を求め,回転エネルギーに対してプロットした.また,発光上準位における占有率のボルツマンプロットが直線から一部外れていることから,水素分子の回転温度が視線方向に一定ではないことが考えられた.

# 目次

第1章	緒言	3
第2章	原理	4
2.1	水素分子	4
	2.1.1 分子のエネルギー準位	4
	2.1.2 分子の振動・回転エネルギー	4
	2.1.3 選択則	5
2.2	基底準位の振動・回転状態占有率の計算	5
	2.2.1 発光上準位の振動・回転状態占有率と発光強度の関係	5
	2.2.2 上準位における振動・回転状態占有率のボルツマンプロットおよび回転温度	6
	2.2.3 コロナモデル	6
	2.2.4 基底準位の振動・回転状態占有率	7
第3章	実験装置	8
3.1	プラズマチャンバ	8
3.2	分光器	8
第4章	発光スペクトルの計測	9
4.1	実験の手順	9
4.2	実験データ	9
4.3	波長校正	9
第5章	解析結果	11
5.1	発光強度	11
5.2	発光上準位における振動・回転状態占有率のボルツマンプロットおよび回転温度	11
5.3	基底準位における振動・回転状態占有率	11
第6章	考察	12
第7章	結言	13
謝辞		14
参考文献		15

図目次	16
表目次	29

### 第1章

## 緒言

新エネルギーとして核融合発電が注目されている背景から、水素や重水素のプラズマ中の状態や、プラズマと炉壁との関係を調べる研究が、数多く行われている。そのうちの一つに、透過プローブを用いて水素原子の入射流束を測定する研究がある [1]. これは、プラズマから飛来する粒子のうち水素原子のみが PdCu 膜を容易に透過できることを利用し、プラズマ中の水素原子密度を求めるものである。しかし、透過プローブの性能は PdCu 膜表面の状態に影響されることがわかっており、またプラズマ中水素分子の振動・回転状態によっても変化する可能性がある。また別の研究では、プラズマ中に置いた炭素やタングステン等の資料に重水素がどれほど吸収されるかを調べている [2]. この研究においても、水素分子の振動・回転状態が吸収に影響を与える可能性がある。以上 2 つの研究のように、水素分子の振動・回転状態はプラズマ中及びプラズマ周辺における反応についての大きな要素になり得る。

そこで本研究では、タングステンの熱陰極を用いた水素プラズマにおける Fulcher- α帯の発光スペクトルを 計測した。またそのスペクトルを解析することで、水素分子基底準位の振動・回転状態占有率分布を求めた。

### 第2章

### 原理

### 2.1 水素分子

水素分子の発光分光計測に必要となる基本事項を説明する.

#### 2.1.1 分子のエネルギー準位

Fulcher-  $\alpha$  遷移に関わる水素分子のエネルギー準位について説明する。図 1 に水素分子のポテンシャル曲線を示す。横軸は分子の核間距離、縦軸はポテンシャルエネルギーである。

図中の記号 X, d, a は分子中の電子のエネルギー準位に対応し,基底準位を X と表し,基底準位と同じスピン多重度を持つ電子励起準位はエネルギーの低い順に A,B,C,...,異なるスピン多重度を持つ電子励起準位は a,b,c,... と表す.また  $\Sigma$  や  $\Pi$  といった記号は,軌道角運動量 L の軸方向への射影成分  $M_L$  の大きさ  $\Lambda = |M_L| = 0,1,2,3,...$  に対応しており,順に  $\Sigma$ ,  $\Pi$ ,  $\Delta$ ,  $\Phi$ , ... を用いる [3].その左上の数字はスピン多重度 2S+1 である [3].分子軸を含む平面についての鏡面反転操作による電子波動関数の符号変化の有無に応じて上付き添え字 + または-を付けており,分子中心についての反転操作による符号変化の有無に応じて下付き添え字 u または u を付けている [3].

それぞれの電子励起準位について振動のエネルギー準位が存在する。図中のv,v',v'' はそれぞれ,X, d, a 準位の振動量子数である。さらに,それぞれの振動励起準位について回転のエネルギー準位が存在し,図中のJ,J',J'' はそれぞれ X, d, a 準位の回転量子数である。

プラズマ中では基底準位  $X^1\Sigma_g^+$  にある水素分子が電子と非弾性衝突することで発光上準位  $d^3\Pi_u^-$  へ励起される.その励起された分子が発光下準位  $a^3\Sigma_g^+$  へ自然放出する際に発光するスペクトル帯が本研究の計測対象とする Fulcher-  $\alpha$  帯である.

### 2.1.2 分子の振動・回転エネルギー

原子核は電子に比べて数千倍重いために分子の振動・回転は電子の運動に比べて十分遅くなり、電子が原子核の位置変化に対して瞬時に追随できるとする近似を Born-Oppenheimer 近似という [3]. この近似を用いると、水素分子を構成する全ての粒子に対してシュレディンガー方程式を同時に解くのではなく、分子の電子波動関数と振動・回転の波動関数を分離することで、振動・回転準位エネルギーを求めることが可能になる.回転による遠心力ひずみを考慮した回転準位エネルギーは以下のように近似的に表すことができる [3].

$$E_{\text{rot}}^v \cong B^{\text{v}} J(J+1) - D_{\text{e}} [J(J+1)]^2$$
 (2.1)

ここで  $B^{\rm v}$  は回転定数, $D_{\rm e}$  は遠心力ひずみ定数であり, $B^{\rm v}$  は平衡点における回転定数  $B_{\rm e}$  と回転定数の 1 次の補正項  $\alpha_{\rm e}$  を用いて  $B^{\rm v}=B_{\rm e}-\alpha_{\rm e}(v+1/2)$  と近似される [3].また,振動準位エネルギーは以下の近似式で表すことができる [3].

$$E_{\rm vib} \cong \overline{\omega}_{\rm e} \left( v + \frac{1}{2} \right) - \overline{\omega}_{\rm e} \chi_{\rm e} \left( v + \frac{1}{2} \right)^2$$
 (2.2)

ここで  $\overline{\omega}_e$  は振動定数, $\chi_e$  は 2 次の補正項である.表 1 にまとめたこれらの分子定数はデータベースから得られる [4].

#### 2.1.3 選択則

分子の電子状態間の遷移には一般的に振動回転状態の遷移が伴うが,そこには選択則が存在する [3]. まず,振動量子数は  $\Delta v=v'-v''=0$  を満たす.また,回転量子数は  $\Delta J=J'-J''=-1,0,1$  を満たすが,J'=J''=0 は禁制遷移である. $\Delta J$  に対応するスペクトル枝をそれぞれ P 枝,Q 枝,R 枝と呼ぶが,本研究では Q 枝について分析を行うので, $\Delta J=0$  である.

### 2.2 基底準位の振動・回転状態占有率の計算

#### 2.2.1 発光上準位の振動・回転状態占有率と発光強度の関係

発光上準位の振動・回転状態占有率  $n_{dv'J'}$  は発光上準位の振動・回転状態占有数  $N_{dv'J'}$  を用いて下式で表す.

$$n_{dv'J'} = \frac{N_{dv'J'}}{\sum_{xx'J'} N_{dv'J'}}$$
 (2.3)

 $N_{dv'J'}$  は発光強度  $I_{av''J''}^{dv'J'}$  を用いて

$$N_{dv'J'} = \frac{I_{av''J''}^{dv'J'} \lambda_{av''J''}^{dv'J'}}{hc} \frac{1}{A_{cv'J''}^{dv'J'}}$$
(2.4)

と表せるので,

$$n_{dv'J'} = \frac{1}{\sum_{v'J'} \frac{I_{av'J'}^{dv'J'} \lambda_{av'J''}^{dv'J'}}{A_{av'J''}^{dv'J'}} \frac{I_{av''J''}^{dv'J'} \lambda_{av''J''}^{dv'J'}}{A_{av''J''}^{dv'J'}} \frac{I_{av''J''}^{dv'J'} \lambda_{av''J''}^{dv'J'}}{A_{av''J''}^{dv'J'}}$$
(2.5)

と書ける.ここで  $\lambda^{dv'N'}_{av''N''}$  は発光線の波長,h はプランク定数,c は光速である. $A^{dv'J'}_{av''J''}$  は自然発光係数であり

$$A_{av''J''}^{dv'J'} = \frac{16\pi^3}{3h\epsilon_0 \lambda_{av''J''}^{dv'J'} {}^3} \overline{R_e}^2 q_{av''}^{dv'} S_{aJ''}^{dJ'} \frac{1}{2J'+1}$$
 (2.6)

と表せる [5].  $\epsilon_0$  は真空の誘電率, $\overline{R_{\rm e}}$  は電気双極子モーメント, $q_{av''}^{dv'}$  は Franck-Condon 因子, $S_{J''}^{J'}$  は Hönl-London 因子,2J'+1 は回転の縮退度である.Fulcher-  $\alpha$  帯では Hönl-London 因子は

である [5].

#### 2.2.2 上準位における振動・回転状態占有率のボルツマンプロットおよび回転温度

上準位の占有数がボルツマン分布に従うと仮定すると、発光上準位の占有率は

$$n_{dv'J'} = \frac{(2J'+1) g_{\rm as}^{J'} \exp\left(-\frac{E_{\rm rot}^{dv'}(J')}{k_{\rm B}T_{\rm rot}^{dv'}}\right)}{\sum_{J'} (2J'+1) g_{\rm as}^{J'} \exp\left(-\frac{E_{\rm rot}^{dv'}(J')}{k_{\rm B}T_{\rm ot}^{dv'}}\right)}$$
(2.8)

と表せる.  $(2J'+1).g_{\rm as}^{J'},E_{\rm rot}^{dv'},T_{\rm rot}^{dv'}$ は、それぞれ発光上準位の回転の縮退度、核スピンの縮退度、回転エネルギー、回転温度であり、 $k_{\rm B}$  はボルツマン定数である。両辺対数をとると、

$$\ln \left[ \frac{n_{dv'J'}}{(2J'+1)g_{\rm as}^{J'}} \right] = const - \frac{E_{\rm rot}^{dv'}(J')}{k_{\rm B}T_{\rm rot}^{dv'}}$$
 (2.9)

となる. 横軸を  $E_{\rm rot}^{dv'}(J')$ , 縦軸を  $n_{dv'J'}$  としてプロットし, 縦軸を対数に取った図を作成すると, その傾きから  $T_{\rm rot}^{dv'}$  を求めることができる.

#### 2.2.3 コロナモデル

電子密度が十分に小さい領域では、発光上準位の占有数変化を、電子衝突励起による基底準位からの流入量と自然放出脱励起による発光下準位への流出量で表すことができる。これをコロナ平衡といい、以下の式で表される[5].

$$\frac{\partial N_{dv'J'}}{\partial t} = n_{\rm e} \sum_{v,J} \left[ N_{XvJ} R_{XvJ}^{dv'J'} \right] - N_{dv'J'} \sum_{v''J''} A_{av''J''}^{dv'J'}$$
(2.10)

ここで  $n_e$  は電子密度であり, $N_{XvJ}$  は基底準位の振動・回転状態占有数である.右辺第 2 項の総和記号は選択則 (v'-v''=0 かつ J'-J''=-1,0,1) を満たす v'',J'' についての和であることに注意する.左辺を 0 とした定常解から,コロナモデルを得られる.

$$n_{\rm e} \sum_{v,J} \left[ N_{XvJ} R_{XvJ}^{dv'J'} \right] = N_{dv'J'} \sum_{v''J''} A_{av''J''}^{dv'J'}$$
(2.11)

式 2.3 より

$$n_{\rm e} \left( \sum_{v,J} N_{XvJ} \right) \sum_{v,J} \left[ n_{XvJ} R_{XvJ}^{dv'J'} \right] = n_{dv'J'} \left( \sum_{v',J'} N_{dv'J'} \right) \sum_{v''J''} A_{av''J''}^{dv'J'}$$
(2.12)

ここで  $n_{XvJ}$  は基底準位の振動・回転状態占有率であり, $n_{XvJ}=N_{XvJ}/\sum_{v,J}N_{XvJ}$  である。 $R_{XvJ}^{dv'J'}$  は電子衝突励起係数であり,Born-Oppenheimer 近似を仮定すると

$$R_{XvJ}^{dv'J'} = q_{Xv}^{dv'} \left\langle \sigma_{v'\leftarrow v}^{FC} v_{e} \right\rangle a_{0J}^{1J'} \delta_{q_{s}}^{g_{as}^{J'}}$$
(2.13)

と書ける [5].  $q_{Xv}^{dv'}$  は Franck-Condon 因子である。 $\sigma_{v'\leftarrow v}^{FC}$  は電子衝突励起断面積であり, $v_{\rm e}$  はマクスウェル分布を仮定した電子の速度分布である。 $a_{0J}^{1J'}$  は回転構造の分岐比, $\delta_{g_{as}}^{g_{as}^{J'}}$  はクロネッカーのデルタである。電子衝突断面積について,本研究では次式のように Franch-Condon 原理と電子衝突励起確率のボルツマン則 (エネルギー差が小さい遷移ほど励起確率が大きい) を仮定したスケーリングを用いた [6].

$$\left\langle \sigma_{v'\leftarrow v}^{FC} v_{\rm e} \right\rangle \propto \left\langle \sigma_{0\leftarrow 0}^{FC} v_{\rm e} \right\rangle \times \exp\left(-\frac{\left(E_{\rm vib}^d(v') - E_{\rm vib}^d(0)\right) - \left(E_{\rm vib}^X(v) - E_{\rm vib}^X(0)\right)}{k_{\rm B} T_{\rm e}}\right) \tag{2.14}$$

 $E_{
m vib}^d(v'), E_{
m vib}^X(v)$  はそれぞれ発光上準位と基底準位の振動エネルギーで,式 2.2 を用いて算出した.  $T_e$  は電子温度である. 回転構造の分岐比は

$$a_{0J}^{1J'} = \sum_{r} \overline{Q'_r} (2J' + 1) \begin{pmatrix} J' & r & J \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^2$$
 (2.15)

と表せる [6] が,ここで  $\overline{Q'_r}$  は電子速度で平均化した部分断面積で,実験的に求められた値 [7] を使用した.なお,右辺の行列は Wigner の 3j 記号である.クロネッカーのデルタ  $\delta^{g^{J'}_{as}}_{g^{J_s}_{as}}$  は,核スピンの対称性が基底準位と発光上準位で同じなら 1,異なれば 0 となる.

#### 2.2.4 基底準位の振動・回転状態占有率

発光上準位と同様に,基底準位の振動・回転状態占有数にもボルツマン分布を仮定する.振動温度を  $T_{\mathrm{vib}}^X$ , 回転温度を  $T_{\mathrm{rot}}^{X_v}$  として, $n_{XvJ}$  は

$$n_{XvJ} = \frac{(2J+1)g_{\rm as}^{J} \exp\left(-\frac{E_{\rm rot}^{Xv}(J)}{k_{\rm B}T_{\rm rot}^{Xv}}\right) \exp\left(-\frac{E_{\rm vib}^{X}(v)}{k_{\rm B}T_{\rm vib}^{X}}\right)}{\sum_{vJ}(2J+1)g_{\rm as}^{J} \exp\left(-\frac{E_{\rm rot}^{Xv}(J)}{k_{\rm B}T_{\rm rot}^{Xv}}\right) \exp\left(-\frac{E_{\rm vib}^{X}(v)}{k_{\rm B}T_{\rm vib}^{X}}\right)}$$

$$= C(2J+1)g_{\rm as}^{J} \exp\left(-\frac{E_{\rm rot}^{Xv}(J)}{k_{\rm B}T_{\rm rot}^{Xv}}\right) \exp\left(-\frac{E_{\rm vib}^{X}(v)}{k_{\rm B}T_{\rm vib}^{X}}\right)$$
(2.16)

と書ける.ここで,(2J+1) は回転の縮退度である. $g_{\rm as}^J$  は核スピンの縮退度であり,J が奇数の時 3,偶数の時 1 となる.また, $C=1/\sum_{vJ}(2J+1)g_{\rm as}^J\exp\left(-\frac{E_{\rm rot}^{Xv}(J)}{k_{\rm B}T_{\rm rot}^{Xv}}\right)\exp\left(-\frac{E_{\rm vib}^X(v)}{k_{\rm B}T_{\rm vib}^X}\right)$  である.式 2.12 のコロナモデルの式に代入すると,発光上準位の占有率は

$$n_{dv'J'} = C' \frac{\sum_{v,J} \left[ R_{XvJ}^{dv'J'} (2J+1) g_{\text{as}}^{J} \exp\left(-\frac{E_{\text{rot}}^{Xv}(J)}{k_{\text{B}} T_{\text{rot}}^{Xv}}\right) \exp\left(-\frac{E_{\text{vib}}^{X}(v)}{k_{\text{B}} T_{\text{vib}}^{X}}\right) \right]}{\sum_{v,'',J''} A_{av'J''}^{dv'J''}}$$
(2.17)

と表せる.ただし,v',J' に依存しない定数を C' にまとめた.また,右辺の  $T_{\mathrm{rot}}^{Xv}$  について,回転温度は回転 定数に比例するという関係式 [8]

$$T_{\text{rot}}^{Xv} = \frac{B^{Xv}}{B^{dv'}} T_{\text{rot}}^{dv'} \tag{2.18}$$

を用いて,2.2.2 章で求めた発光上準位の回転温度から計算できる.式 2.5 によって求めた  $n_{dv'J'}$  を代入し,右辺の  $T_{\mathrm{vib}}^X$  をフィッティングによって求めることができる.

以上の手順で求まった基底準位の振動・回転温度を式 2.16 に代入することにより,基底準位の振動・回転 状態占有率を求めることができる.

### 第3章

# 実験装置

### 3.1 プラズマチャンバ

本研究で用いたプラズマチャンバの外観を図 2 に、チャンバの構造を簡単にした図を図 3 に示す.プラズマチャンバは主に ICF-152 規格のスレンレス製六方クロス管が用いられている.流量調節バルブは水素ボンベに繋がっており,このバルブでチャンバ内の水素の圧力を調節することができる.圧力計 (PFEIFFER VACUUM PKR251) が取り付けられており,チャンバ内の圧力を調べることができる.排気口はロータリーポンプ (アネスト岩田,ISP-250B-SV) とターボ分子ポンプ (大阪真空機器製作所,TH162CA) に繋げた.カソードには直径 0.5 mm のタングステンフィラメントを使用し,アノードとして直径 50 mm の平板電極を使用した.カソードの両端は直流電源(菊水電子工業,REGULATED DC POWER SUPPLY)に繋ぎ,電流は 20 A 程度になるように調整することで,フィラメントから熱電子を放出させた.アノードとカソードは別の直流電源 (高砂製作所,GP 0110-3) に繋げた.チャンバには石英窓が取り付けられており,ここにコリメータを付けた光ファイバーを繋ぐことで,プラズマの光を光学系へ取り込んだ.

### 3.2 分光器

分光器の概略図を図 4 に示す.プラズマからの光は,コリメータを用いて集光したものを光ファイバーでツェルニ・ターナー型分光器(堀場製作所,HR640)へ入射させている.分光器入り口にはスリットを設置していて,その幅は  $50~\mu m$  である.スリットを通過した光はコリメートミラーで平行光となり,回折格子に入射する.この回折格子は有効幅が 10~cm,刻線数は  $2400~ext{4}/m m$  である.回折格子で反射した光は,ミラーで反射した後 CCD カメラ(Finger Lakes Instrumentation,ML1109)で検出される.CCD カメラの仕様 [9] を表 2 に示す.CCD カメラが一度に計測できる波長範囲は 8.8~n m だが,回折格子からの光はこの幅を超えて広がるので,回折格子をステッピングモーターで回転させることで,広い波長範囲の計測を行えるようになっている.また,ステッピングモーターおよび CCD カメラを Python のプログラムで制御することで,複数の波長範囲に対応する画像を自動的に撮影することができる.

### 第4章

## 発光スペクトルの計測

### 4.1 実験の手順

以下の手順に沿って発光スペクトルを計測した.

- 1. 流量調節バルブを閉じ切って圧力が  $10^{-6}$  Torr 程度に下がっていることを確認した
- 2. 流量調節バルブを少しずつ開き、圧力が  $10^{-3}$  Torr 程度になるまで水素を注入した.
- 3. カソードに電圧を印加し、電流が20A程度になるように調節した.
- 4. アノード, カソード間に電圧を印加し, プラズマを生成した. プラズマ電流が 2.5 A になるように調節 した.
- 5. CCD カメラでスペクトルの撮影を行った. ステッピングモーターを回して撮影する波長帯を変えながら複数の画像を得た.
- 6. アノード,カソード間の電源を切ってプラズマを消した後,同様に撮影を行った.

### 4.2 実験データ

図 5 に、上述の手順 5 で撮影した画像の例を示す。図 6 は画像の各ピクセルが出力した値を縦に合計したものをプロットしたグラフである。また、アノードに電流を流したまま電極間の電流を止めてプラズマを消した状態で同様にデータを取ったものが図 7 である。横方向のピクセルが 1027 のデータが不自然なことが見て分かるが、これは CCD カメラのある一つのピクセルが、光の強度に関わらず異常な値を出力していることが原因である。プラズマをつけて得たデータからプラズマを消したバックグラウンドのデータを減算することで、このようなノイズを打ち消すことができる。バックグラウンドのデータを除いたものが図 8 である。以降の解析では、全ての画像に対してこの処理を施したものを使用した。

#### 4.3 波長校正

横方向のピクセルを波長に変換するために、波長校正を行った。まず、光の強度が最大となるピクセルを発光線の中心とし、その中心に対してデータベース [10] から取得した Fulcher-  $\alpha$  帯発光線の波長をプロットした。さらに、二次関数でフィッティングすることで、ピクセルと波長の対応関係を得た (図 9)。得られた対応関係からピクセルを波長に変換した。波長校正後のスペクトルを図 10 に示す。なお、(J',J'')=(1,1),(2,1)

 $2), \dots$  の発光線を順に  $Q1, Q2, \dots$  としている.

### 第5章

## 解析結果

### 5.1 発光強度

発光強度は,発光線スペクトルの面積を計算して求められる.得られた発光線スペクトルを歪正規分布関数でフィッティングすることで面積を求めた.例として,Q2(0-0) のフィッティング結果を図 11 に示す.図中の網掛け部分の面積が発光強度である.また,複数の発光線が重なった形をしているものは,歪正規分布関数を足し合わせたものを使いフィッティングすることで分離した.例として,Q7(0-0) のフィッティング結果を図 12 に示す.はっきりと発光線が区別できるものは,(v'-v'')=(0-0) では Q7,(v'-v'')=(1-1),(2-2)では Q5 までだったので,それら計 17 本の発光線を解析の対象とした.

# 5.2 発光上準位における振動・回転状態占有率のボルツマンプロットおよび回転温度

式 2.5 を用いて,上準位における振動・回転状態占有率を求めた.そしてその占有率を,横軸に  $E_{\rm rot}^{dv'}$ ,縦軸に  $\frac{n_{dv'J'}}{(2J'+1)g_{\rm as}^{J'}}$  を取ったグラフにプロットした.それを図 13 に示す.なお,縦軸は対数にとり,ボルツマンプロットとした.v'=1,2 のグラフの形はほぼ直線であり,発光上準位の占有数がボルツマン分布に従うことがわかる.一方,v'=0 のグラフは回転量子数が大きい部分では形が直線から外れており,ボルツマン分布に従っていないことがわかる.式 2.9 を用いてフィッティングすることによって,回転温度を求めた.ただし,v'=0 のデータのフィッティングには,グラフが直線とみなせる  $J'=1\sim5$  のみを用いた.図 14,図 15,図 16 にフィッティング結果,表 3 に得られた回転温度を示す.

### 5.3 基底準位における振動・回転状態占有率

式 2.13 より電子衝突励起係数を求めた. さらに、式 2.18 より基底準位の回転温度を求め、これらの値を式 2.17 に代入した. 式 2.17 の左辺は式 2.5 によって計算できるが右辺の値は  $T_{vib}^X$  によって変化するので、左辺 の値と右辺の値が一番近くなるように  $T_{vib}^X$  を決定した. このフィッティング結果を図 17 に示す. 図の横軸は 解析に使用したデータの順番を表し、 $1\sim17$  まで順に  $(v',J')=(0,1)\sim(0.7),(1,1)\sim(1,5),(2,1)\sim(2,5)$  となっている. また、振動温度と回転温度を表 4 に示す. 求まった振動温度と回転温度を式 2.16 に代入して、基底準位の占有率を求めた. これを図 18 に示す.

### 第6章

# 考察

図 14 に関して,発光上準位の振動・回転状態占有率がボルツマン分布に従うとするとこのグラフは直線になるはずだが,実際は v'=0 の J'=6,7 の点は大きな値になっている.このことから,回転温度は視線方向に一定ではないことが考えられる.高回転量子数域を含めた発光上準位の占有数のボルツマンプロットが直線から外れることは,他のプラズマでも報告されている.図 20 は,岐阜県土岐市の核融合科学研究所にある大型へリカル装置 (LHD) でのプラズマにおける,発光上準位における占有数のボルツマンプロットである [11].図中の点線は高低 2 温度のボルツマン分布を仮定したフィッティング結果であり,良く近似できていることが分かる.また,発光上準位の占有数分布が 2 温度のボルツマン分布で良く近似できることは,放電の種類に関わらず複数計測されている [11, 12, 13].本研究の対称としたプラズマでも,より光分解能の分光器を用いて高回転量子数域までデータを取り,2 温度のボルツマン分布を仮定することで,正確な占有率を計算することができると考えられる.

### 第7章

## 結言

熱陰極グロー放電プラズマにおいて、ツェルニ・ターナー型分光器を用いて 600-630 nm の波長域の水素分子の発光スペクトルを計測した。データベースから得た発光線の波長データとスペクトルを比較することによって、波長校正を行い、発光線の特定を行った。Fulcher-α帯Q 枝スペクトルとして特定できた発光線は17 本であった。得られたスペクトルを歪正規分布関数でフィッティングし、面積を計算することで、発光強度を求めた。さらに、発光強度から発光上準位の振動・回転状態占有率を計算した。計算した占有率の、回転エネルギーに対するボルツマンプロットを作成すると、振動量子数が5以下の領域ではデータが直線状に並んだ。発光上準位の占有率がボルツマン分布に従うと仮定し、ボルツマンプロットを直線でフィッティングすることにより、その傾きから発光上準位の回転温度を求めた。回転温度は265-310 Kであった。発光上準位の占有数に関する方程式から導出されるコロナモデルを適用した。さらに基底準位の振動・回転状態占有率にボルツマン分布を仮定することで、基底準位の振動温度をフィッティングにより求めた。基底準位の振動温度は4146 Kであった。さらに、発光上準位の回転温度と基底準位の回転温度の関係式により、基底準位の回転温度は532-621 Kであると求まった。基底準位の回転温度と振動温度をボルツマン分布の式に代入することで、基底準位の振動・回転状態占有率を求め、回転エネルギーに対してプロットした。また、回転量子数が6以上の領域で発光上準位における占有率のボルツマンプロットが直線から外れることから、水素分子の回転温度が視線方向に対して一定ではないことが考えられた。

# 謝辞

本論文を作成するにあたり,蓮尾昌裕教授,四竈泰一准教授,ArseniyKuzmin 講師,藤井恵介助教には研究会等で多くのご指導をしていただきました.特に ArseniyKuzmin 講師には研究方針の他,実験装置のセッティングから解析手法についてまで相談に乗ってくださり,的確な指摘をして下さりました.光工学研究室の先輩方にも,多くの助言を頂きお世話になりました.また,同期の皆様と楽しく研究をすることができました.お世話になった全ての方々に,この場をかりて心から感謝いたします.

# 参考文献

- [1] 尹弘樹, 修士論文, 京都大学 (2021).
- [2] L. Begrambekov, A. Ayrapetov, V. Ermakov, A. Kaplevsky, Ya. Sadovsky, and P. Shigin, Nucl. instrum. methods phys. res., B, Beam interact. mater. atoms, **315**, pp.110-116 (2013).
- [3] 菱川明栄, プラズマ・核融合学会誌 80, pp.742-748 (2004).
- [4] Nist chemistry webbook (https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C1333740& Units=SI&Mask=1000#Diatomic).
- [5] 門信一郎, 山崎大輔, 飯田洋平, 肖炳甲, プラズマ・核融合学会誌 80, pp.783-792 (2004).
- [6] 門信一郎, プラズマ・核融合学会誌 80, pp.749-756 (2004).
- [7] D. R. Farley, D. P. Stotler, D. P. Lundberg, and S. A. Cohen, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 112, pp.800-819 (2011).
- [8] S. A. Astashkevich and B. P. Lavrov, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 56, pp.725–51 (1996).
- [9] 田中光化学工業株式会社 HP (http://www.tanaka-opt.co.jp/fli-ml1109.html).
- [10] H. M. Crosswhite, The hydrogen molecule wavelength tables of Gerhard Heinrich Dieke, (Wiley-Interscience, 1972).
- [11] 石原啓基, 修士論文, 京都大学 (2020).
- [12] S. Briefi, D. Rauner, and U. Fantz, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 187, pp.135–144 (2017).
- [13] P. Vankan, D. C. Schram, and R. Engeln, Chemical physics letters, 400, pp.196–200 (2004).

# 図目次

1	$H_2$ のポテンシャル曲線 $\dots$	17
2	プラズマチャンバの外観	18
3	プラズマチャンバの構造の簡略図	19
4	分光器の概略図....................................	20
5	CCD カメラで撮影した画像の例	20
6	画像のピクセル値を縦に合計したグラフの例	21
7	バックグラウンドデータの例	21
8	バックグラウンドを除いたスペクトルの例	22
9	ピクセルと波長の関係の例	22
10	Fulcher-α帯 Q 枝発光スペクトル	23
11	歪正規分布関数によるフィッティングの例	23
12	歪正規分布関数フィッティングによる分離の例	24
13	上準位占有数のボルツマンプロット	24
14	発光上準位回転温度のフィッティング $(v'=0)$	25
15	発光上準位回転温度のフィッティング $(v'=1)$	25
16	発光上準位回転温度のフィッティング $(v'=2)$	26
17	基底準位振動温度のフィッティング結果	26
18	基底準位の占有数分布	27
19	Q3(0-0) スペクトル	27
20	LHD での上準位占有数のボルツマンプロット	28

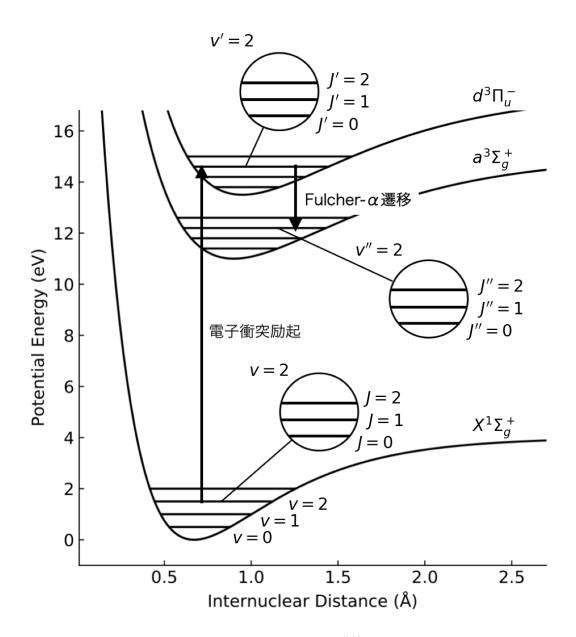


図 1  $H_2$  のポテンシャル曲線

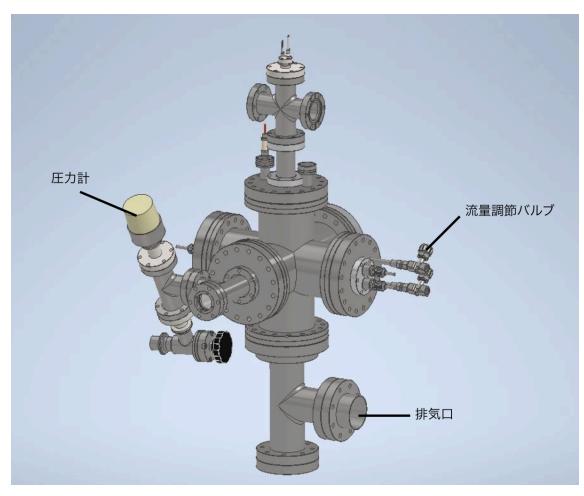


図2 プラズマチャンバの外観

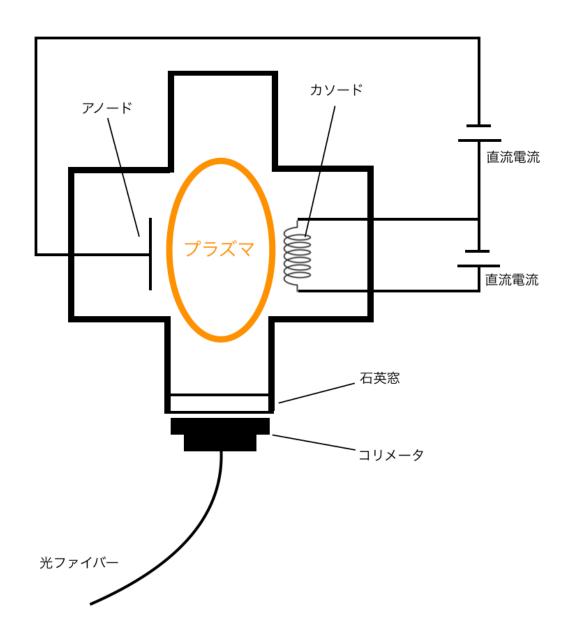


図3 プラズマチャンバの構造の簡略図

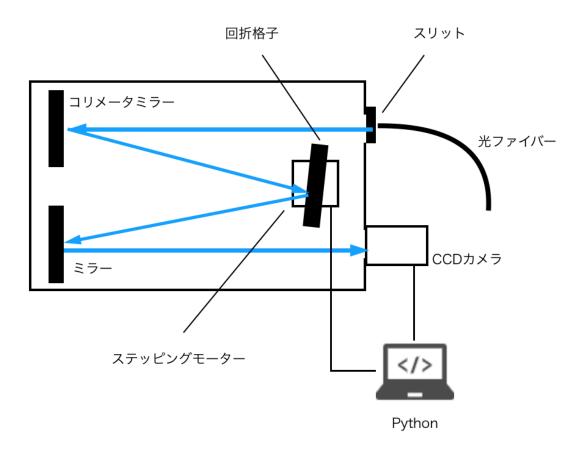


図4 分光器の概略図

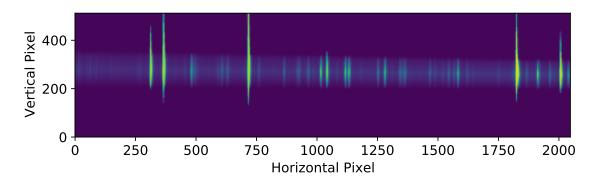


図 5 CCD カメラで撮影した画像の例

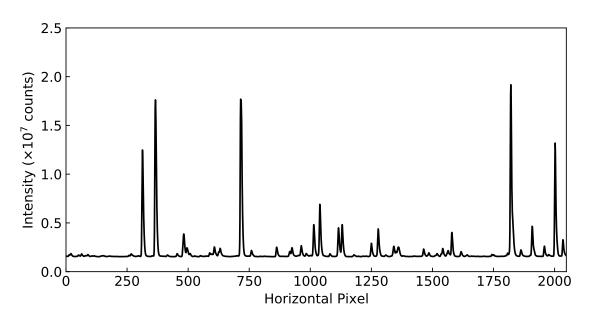


図 6 画像のピクセル値を縦に合計したグラフの例

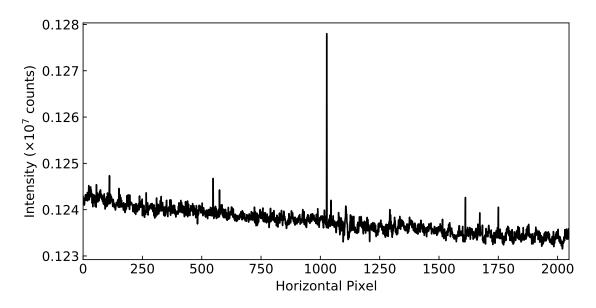


図7 バックグラウンドデータの例

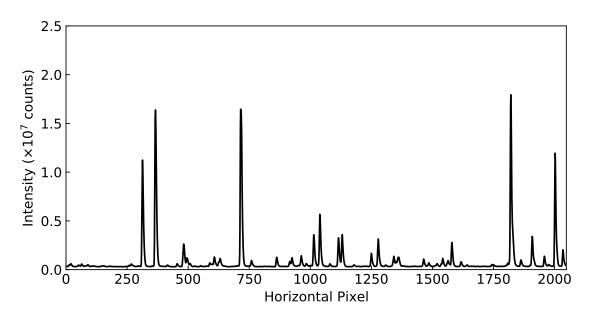


図8 バックグラウンドを除いたスペクトルの例

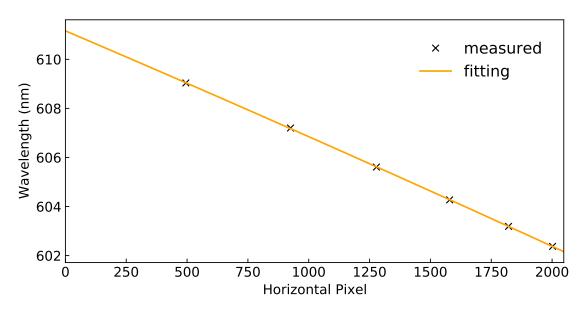


図 9 ピクセルと波長の関係の例

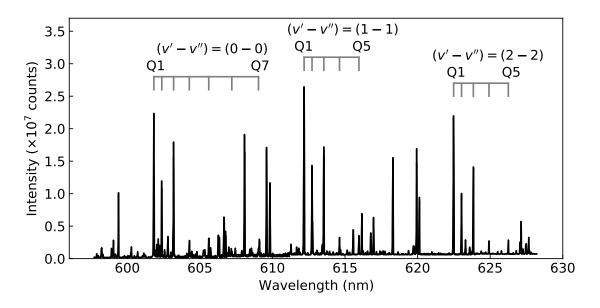


図 10 Fulcher-α帯 Q 枝発光スペクトル

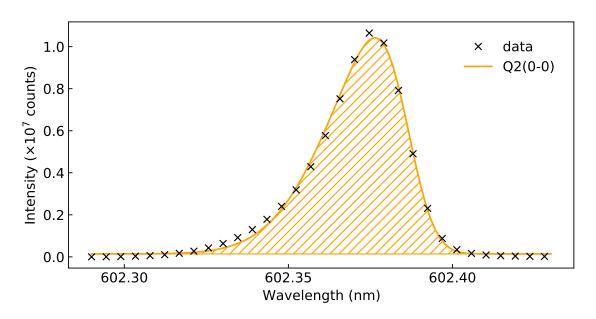


図 11 歪正規分布関数によるフィッティングの例

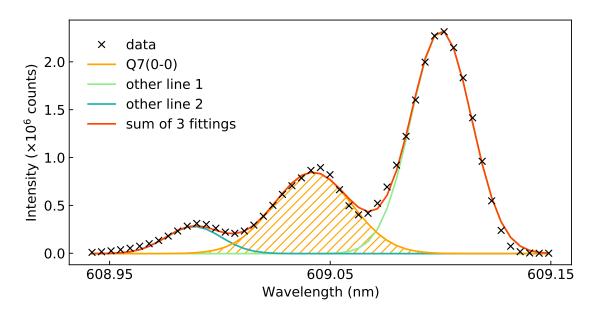


図 12 歪正規分布関数フィッティングによる分離の例

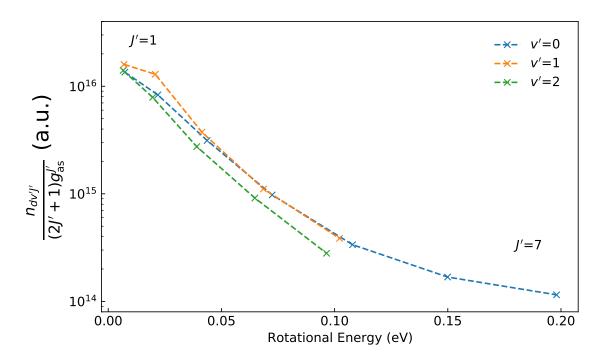


図 13 上準位占有数のボルツマンプロット

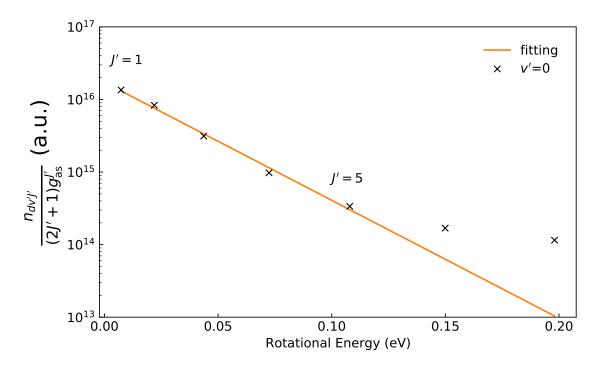


図 14 発光上準位回転温度のフィッティング (v'=0)

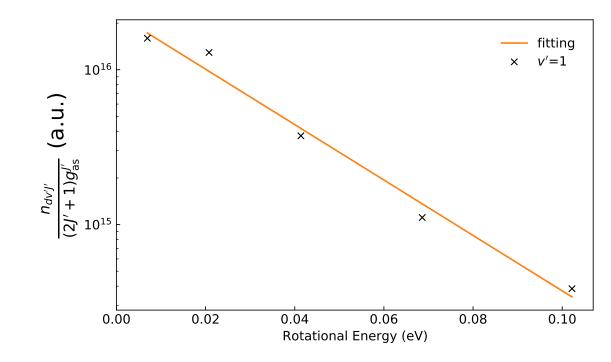


図 15 発光上準位回転温度のフィッティング (v'=1)

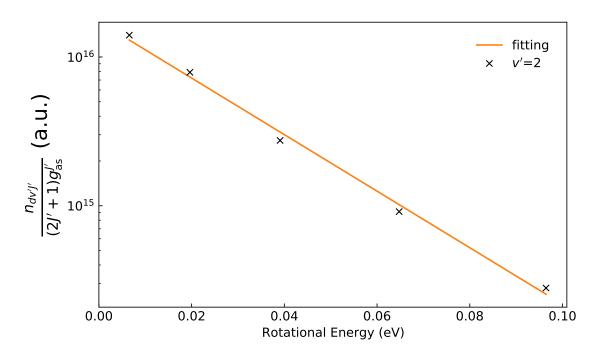


図 16 発光上準位回転温度のフィッティング (v'=2)

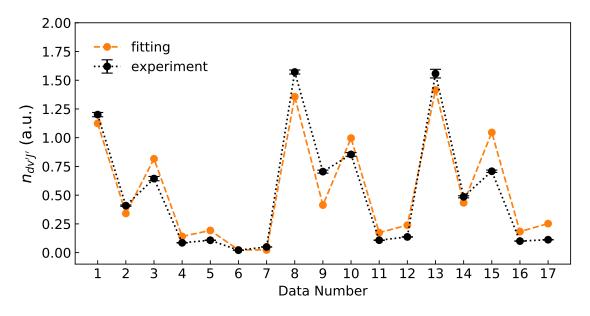


図 17 基底準位振動温度のフィッティング結果

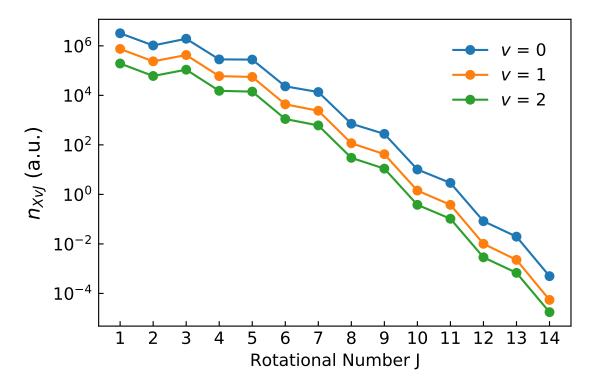


図 18 基底準位の占有数分布

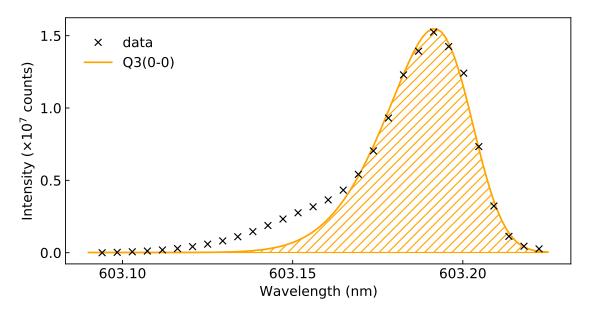


図 19 Q3(0-0) スペクトル

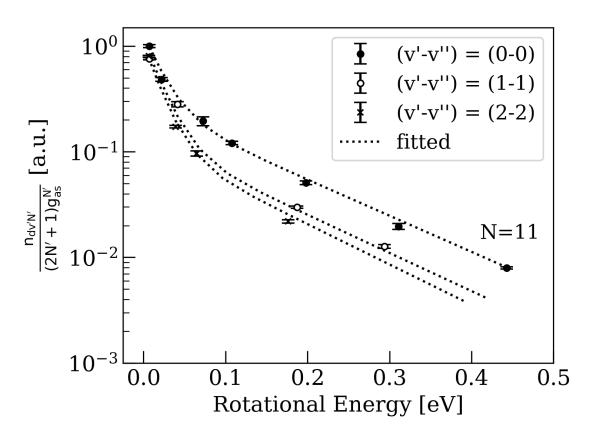


図 20 LHD での上準位占有数のボルツマンプロット

# 表目次

1	水素分子の分子定数 [4]	29
2	CCD カメラの仕様一覧 [9]	29
3	発光上準位の回転温度	29
4	基底準位の振動・回転温度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30

表 1 水素分子の分子定数 [4]

準位	$D_{\rm e}~[{\rm cm}^{-1}]$	$B_{\rm e}~{ m [cm^{-1}]}$	$\alpha_{\rm e}~[{\rm cm}^{-1}]$	$\overline{\omega_{\rm e}} \ [{\rm cm}^{-1}]$	$\overline{\omega_{\rm e}}\chi_{\rm e}~{\rm [cm^{-1}]}$
$X^1\Sigma_g^+$ (基底準位)	0.0471	60.853	3.062	4401.21	121.33
$d^3\Pi_u^-$ (発光上準位)	0.0191	30.364	1.545	2371.57	66.27
$a^3\Sigma_g^+$ (発光下準位)	0.0216	34.216	1.671	2664.83	71.65

表 2 CCD カメラの仕様一覧 [9]

型番	ML1109	
CCD イメージセンサ	浜松ホトニクス S10140-1109	
イメージセンサのサイズ	24.6 x 6.07 mm	
解像度	2048 x 506 pixel	
画素サイズ	12 x 12 µm	
インターフェイス	USB2.0	
シャッター	45 mm	
重量	1.3 kg	
サイズ	94 x 94 x 121.3 mm	

表 3 発光上準位の回転温度

振動準位	$T_{\rm rot}^{dv'}$ [K]
v=0	310
v=1	282
v=2	265

表 4 基底準位の振動・回転温度

振動準位	$T_{\mathrm{rot}}^{Xv}$ [K]	$T_{\mathrm{vib}}^{X}$ [K]
v=0	621	4146
v=1	565	4146
v=2	532	4146